

## دستگاه عملیات سطحی Uv-Ozone

## Uv-Ozone Surface Treatment System

### UZ-1926



مرحله نخست ساخت سلول خورشیدی تمیز کردن سطح زیرلایه با دقت بسیار زیاد است. این مرحله که وقت زیادی می گیرد در بسیاری از موارد منتج به تمیزی در ابعاد اتمی نمی شود. همین موضوع بر روی لایه نشانی های بعدی و در نهایت بر روی خواص الکتریکی سلول اثر منفی می گذارد. آلودگی هایی از قبیل چربی پوست انسان، رزین های افزودنی، روغن های روان ساز، حلال ها و بخار آنها، سولفید ها، آلودگی هایی که در زمان طولانی در هوا جذب می شوند، بخار روغن های پمپ خلا و روغن های آرایشی، با آب و حلال تمیز نمی شود. همچنین حلال ها خود روی سطح باقی می مانند.

استفاده از UV-Ozone شرایطی را ایجاد می کند که کلیه مواد آلی روی سطح اکسید شده و سطح به طور کامل تمیز می شود. این موضوع در تست های اندازه گیری زاویه تماس به روشنی خود را نشان می دهد. مکانیسم عمل در واقع ایجاد شرایط کنترل شده و بهینه شده ای است که نمونه ها به طور توأم در معرض دور مشخصی از UV و اوزون قرار می گیرند. امکان ورود اکسیژن به داخل سیستم وجود دارد و زمان اعمال UV-Ozone به وسیله تایمر تعیین می شود.

برخی از کاربرد های دستگاه شامل موارد زیر است:

تمیز کردن زیر لایه ها قبل از لایه نشانی  
تمیز کردن ویفر های سیلیکون، لنز ها، آینه ها، پنل های  
خورشیدی، ورق های استیل، قطعات درونی گایدها  
تمیز کردن مدار های هیبریدی، پنل های صاف LCD  
اچینگ تفلون، وایتون و دیگر مواد آلی  
افزایش لایه اکسید غیر فعال سطحی Si و GaAs  
از بین بردن پلاستیک ویفر ها  
افزایش چسبندگی پوشش روی پلاستیک  
از بین بردن جوهر روی ویفر  
پاک کردن فوتورزیست ها  
پاک کردن صفحه های لیتوگرافی  
افزایش آبدوستی سطح  
رشد لایه های اکسیدی روی ویفر سیلیکون  
تمیز کردن اسلاید ها و پروب های میکروسکپ و فیبرها و لنز های  
اپتیکی

**ابعاد دستگاه:** سانتیمتر ۳۰ x سانتیمتر ۲۵ x سانتیمتر ۳۰